## α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 基板上にミスト CVD 成長させた α-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 薄膜の表面緩和構造

Surface relaxation structure of α-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> films grown on α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> substrates by mist CVD

○尾坂 駿<sup>1</sup>、丹波 大樹<sup>1</sup>、高橋 一暉<sup>1</sup>、織田 真也<sup>2,3</sup>、金子 健太郎<sup>4</sup>、田畑 博史<sup>1</sup>、久保 理<sup>1</sup>、藤田 静雄<sup>4</sup>、片山 光浩<sup>1</sup>

(1. 阪大院工、2,4. 京大院工、3. FLOSFIA(株))

°Shun Osaka<sup>1</sup>, Daiki Tamba<sup>1</sup>, Kazuki Takahashi<sup>1</sup>, Masaya Oda<sup>2,3</sup>, Kentaro Kaneko<sup>4</sup>,

Hiroshi Tabata<sup>1</sup>, Osamu Kubo<sup>1</sup>, Shizuo Fujita<sup>4</sup>, and Mitsuhiro Katayama<sup>1</sup>

(1. Grad. Sch. Eng., Osaka Univ., 2. Dept. of Electronic Science and Engineering, Kyoto Univ.,

3. FLOSFIA INC., 4. . Photonics and Electronics Science and Engineering Center, Kyoto Univ.)

E-mail: osaka@nmc.eei.eng.osaka-u.ac.jp

[はじめに] α-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>は、大きなバンドギャップを持つことから GaN や SiC よりも高耐圧かつ低損失な次世代パワーデバイス材料として期待されてお り、最近ミスト CVD 法により低コストで高品質な薄膜が成長可能であるこ とが発見された材料である<sup>[1]</sup>。コランダム結晶であるのでミスト CVD 法に よって他のコランダム結晶との混晶を容易に作製できるという特徴がある。 例えば、α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> との混晶系においてバンドギャップの制御や磁性の発現が 可能という報告<sup>[2]</sup>もあり、新機能創生が期待できるので注目を集めている。 パワーデバイス応用では、その特性に影響を与える電極等他物質との接触界 面構造の理解が重要であるが、その基礎となる α-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の表面構造はほとん ど研究されていなかった。そこで我々は同軸型直衝突イオン散乱分光

(CAICISS) 法を用いて α-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の表面構造を解析した。既にサファイア上の(0001)薄膜の最表面層の原子種については報告している<sup>[3]</sup>が、今回は(0001) 薄膜、さらに (1102)薄膜の表面緩和構造を解析した結果を報告する。

[実験・結果] (0001)表面に対する垂直方向への原子層の配列は、最表面から 順に、Ga-O-Ga-…であると以前報告した<sup>[3]</sup>。また、(1102)表面は O-Ga-O-Ga-O-…であることが分かった。α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の表面緩和構造に関する報告<sup>[4][5]</sup>を参考 にして、2種類の表面それぞれに対して図3に示す緩和モデルを作製した。 緩和モデルではバルクモデルに比べて最表面原子層と第2原子層との距離 を、(0001)表面は80%、(1102)表面は91%短くした。入射角10度におけるGa 散乱強度の方位角依存性の測定結果とこれら緩和モデルに対するシミュレ ーション結果を図1、図2に示す。シミュレーション結果は測定結果と良い 一致を示しており、緩和モデルの妥当性を示している。



D. Shinohara, S. Fujita : Jpn. J. Appl. Phys, **47**, 7311 (2008).
K. Kaneko *et al.* : J. Appl. Phys. **113**, 233901 (2013).
丹波大樹 他 : 2014 年秋季応用物理学会 17p-A6-2.
P. Guenard *et al.* : Surf. Rev. Lett. **5**, 321 (1997).



図 1 (0001)表面の Ga 散乱強度の 方位角依存性(入射角 10 度) (a) 測定結果





Ga Intensity [arb.units]

Azimuth Angle  $\phi$  [deg.]

図 2 (1102)表面の Ga 散乱強度の 方位角依存性(入射角 10 度) (a) 測定結果

<sup>[5]</sup> T. Trainor *et al.* : Surf. Sci. **496**, 238 (2002).

<sup>(</sup>b) シミュレーション結果